

特許
技術

GMP
対応

収率向上の3つのゼロ提案

PIC/S GMP Annex1 対応

残液ゼロシステム

用途

注射剤・点眼剤等、ろ過フィルターのある調製設備における残液の削減、収率の向上を実現するシステムです。

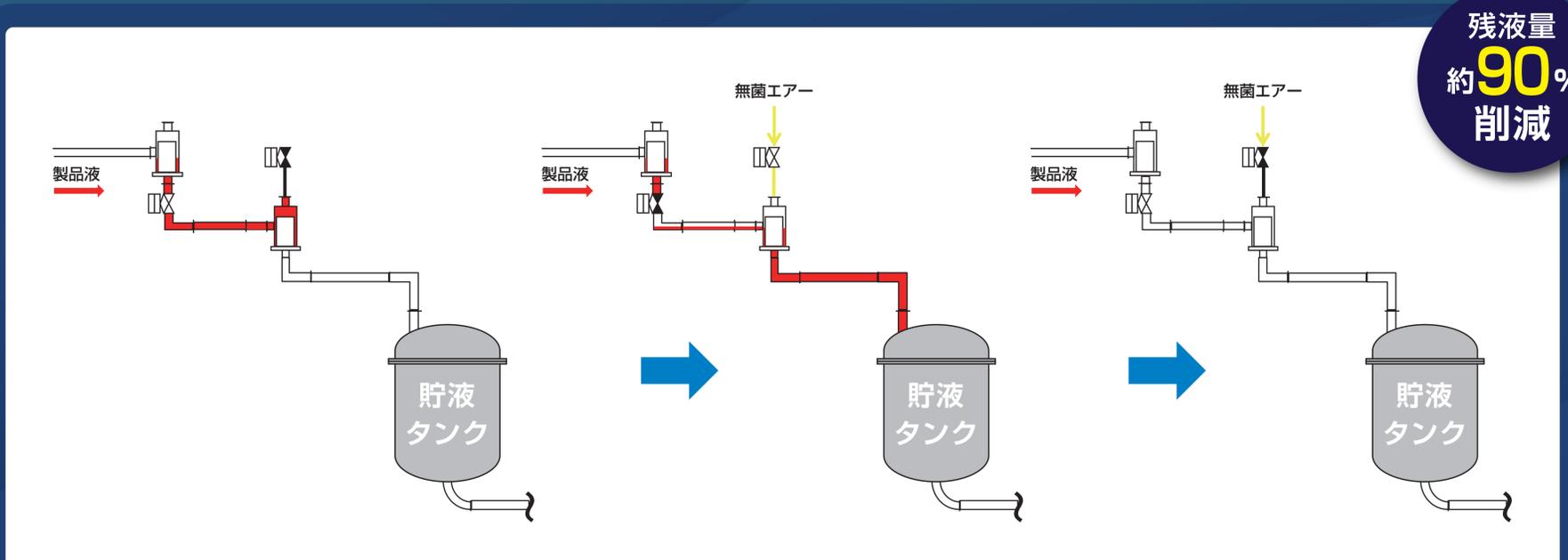
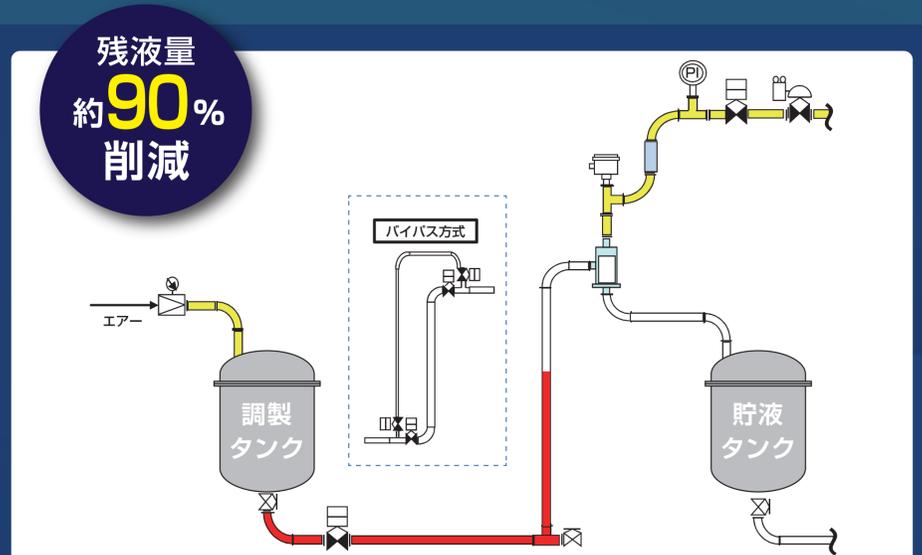
特長

高付加価値製剤に最適なシステム

豊富な調製設備実績に裏付けされた蓄積データと制御技術の融合により、高い収率の得られるシステムを実現しました。多段ろ過システムにも対応可能です。

● 同フロア調製設備の高収率を実現

調製タンク～貯液タンクを同フロアに設置した場合の立ち上がり配管内残液量を最小限とします。小口径バイパス方式により、発泡を抑制しつつ送液します。



● 多段フィルター間の残液を削減

多段ろ過する際のフィルター間の配管内残液量を最小限にします。
(無菌エアの送液制御により、製品液をフィルターの2次側へ送液します。)